

**Workshop**  
**VUV und XUV**  
**Neue Chancen für die Vermessung von Mikrosystemen**

**Ort:** Laser-Laboratorium Göttingen e.V.  
Hans-Adolf-Krebs-Weg 1, 37077 Göttingen

**Termin:** 5. Oktober 2005, 10.30 Uhr

**Moderation:** Dr. Hans-Jürgen Hartmann, PhotonicNet GmbH

**Tagesordnung**

Ab 10:00	Anmeldung		
10:30	Begrüßung durch den Gastgeber	Prof. Dr. Gerd Marowsky Laser-Laboratorium Göttingen	
10:40	Zielstellung des Workshops	Dr. Matthias Künzel VDI/VDE Innovation + Technik GmbH	
10:50	Extrem ultraviolette Lichtquellen für Lithographie- und Mikrosystemtechnik-Applikationen	Dr. Uwe Stamm Xtreme Technologies GmbH	
11:05	VUV- und XUV-Quellen für messtechnische Anwendungen	Gerd Spiecker Lambda Physik AG	
11:20	Kaffeepause		
11:35	Erfahrungen und Visionen zur Mikroskopie mit kurzen Wellenlängen	Dr. Thomas Sure Leica Microsystems CMI GmbH	
11:50	Messen mit Licht im Hochauflösungsbereich: Herausforderungen und Chancen	Prof. Dr. Wolfgang Osten Universität Stuttgart / ITO	
12:05	Informationen zu aktuellen Bekanntmachungen des BMBF und des BMWA	Dr. Matthias Künzel VDI/VDE Innovation + Technik GmbH	
12:20	Mittagsimbiss		
13:15	Vorführung und Experiment XUV-Quellen (Table-Top, Hochleistung)	Laser-Laboratorium Göttingen Xtreme Technologies GmbH	
14:00	Workshop 1: Direkte & indirekte Quellen Leitung: Dr. Uwe Stamm	Workshop 2: Bauteile & Komponenten Leitung: Dr. Mark Andreas Bader	Workshop 3: Messtechnische Anwendungen mit kurzen Wellenlängen Leitung: Prof. Dr. Wolfgang Osten
	Einführung Vorstellung der Teilnehmer Diskussion	Einführung Vorstellung der Teilnehmer Diskussion	Einführung Vorstellung der Teilnehmer Diskussion
16:15	Kaffeepause		
16:30	Abschlussdiskussion	Workshop-Leiter	
17:00	Schlusswort		